

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 1 年 9 月 5 日 (2019.9.5)

【公開番号】特開 2018-117020 (P2018-117020A)
【公開日】平成 30 年 7 月 26 日 (2018.7.26)
【年通号数】公開・登録公報 2018-028
【出願番号】特願 2017-6178 (P2017-6178)
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L	23/50	H
H 0 1 L	23/50	A
H 0 1 L	23/50	D
H 0 1 L	23/50	R

【手続補正書】
【提出日】令和 1 年 7 月 26 日 (2019.7.26)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 6
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項 6】

前記レジストマスクを形成する工程において、前記銅板の表面側のめっき層を覆うレジストマスクを、前記柱状部の上面における前記めっき層周縁に前記銅板が 5 ~ 30 μm 露出するように形成することを特徴とする請求項 4 に記載のリードフレームの製造方法。